

★電子部品・材料研究会 (CPM)

専門委員長 野毛 悟 副委員長 廣瀬文彦

幹事 小館淳一・岩田展幸 幹事補佐 坂本 尊・中村雄一

日時 11月6日(金) 13:00~17:00

7日(土) 9:00~12:50

会場 長岡市地域交流センターまちなかキャンパス長岡 501 会議室(長岡市大手通 2-6 フェニックス大手イースト 5 階. JR 長岡駅大手(西)口から大手通りを直進, 徒歩 5 分, 左手の建物. <http://www.machicam.jp/index.html>
TEL [0258] 39-3300 (会場) 安井寛治(長岡技科大)

議題 薄膜プロセス・材料, 一般

6日

1. Cl フリー溶液を用いてゾルゲル硫化法により作製した $\text{Cu}_2\text{ZnSnS}_4$ 薄膜の品質改善
○宮澤勇斗・岡本崇義・田中久仁彦(長岡技科大)
2. 非真空プロセスによる銅ハライド透明薄膜の作製
○田尾翔子・原田大雅・田中久仁彦(長岡技科大)・森谷克彦(鶴岡高専)
3. 溶液成長法による SnS 薄膜堆積における溶液温度の影響 神田祐作・○高野 泰・石田明広(静岡大)
4. BKT-BT セラミックスの圧電特性における粒径依存性 ○児玉智哉・番場教子(信州大)
5. 低ダメージスパッタ堆積プロセスを利用した有機 EL 素子用電極膜の作製
○星 陽一・濱口大地・小林信一・内田孝幸・澤田 豊(東京工芸大)・清水英彦(新潟大)
6. 室温成膜した SiN_x 膜の特性評価
○佐藤 勝・武山真弓(北見工大)・小林靖志・中田義弘・中村友二(富士通研)・野矢 厚(北見工大)
7. ラジカル窒化による遷移金属窒化物の有用性
○武山真弓・佐藤 勝(北見工大)・青柳英二(東北大)・野矢 厚(北見工大)
8. 表面処理条件の異なる $\text{YAlO}_3(001)$ 基板上に成膜した Cr_2O_3 薄膜の結晶構造解析及び磁気特性
橋本浩佑・隅田貴士・福井慎二郎・永田知子・山本 寛・○岩田展幸(日大)
9. 面内配向成長した単層カーボンナノチューブの自由電子レーザー照射効果と触媒形状依存性
川口大貴・吉田圭佑・小林弥生・春宮清之介・永田知子・山本 寛・○岩田展幸(日大)
10. [招待講演] レーザー制御 Eu^{3+} 化合物量子コンピューターの可能性 打木久雄(長岡技科大)

7日

1. スパッタ法によりエレクトロクロミック素子用水素添加 Mg-Ni 薄膜の作製
○清水英彦・岩野春男・川上貴浩・福嶋康夫・永田向太郎(新潟大)
2. 有機金属分解法により作製した $\text{Nd}_{0.5}\text{Bi}_{2.5}\text{Fe}_4\text{GaO}_{12}$ 薄膜の磁気異方性
○箸中貴大・佐々木教真・石橋隆幸(長岡技科大)・加藤剛志・岩田 聡(名大)・谷山智康(東工大)
3. 磁気光学 3次元ディスプレイの書き込みエネルギーの低減及び回折効率の向上
○根本亜紀・山崎和樹・津田宗太郎・工藤 慧・中村和樹・後藤太一・高木宏幸・林 攀梅・井上光輝(豊橋技科大)
4. 磁気光学 3次元ディスプレイのための磁性フォトニック結晶の角度依存性の改善
○酒井将生・工藤 慧・中村和樹・後藤太一・高木宏幸・林 攀梅・井上光輝(豊橋技科大)
5. Si 太陽電池用 Al_2O_3 光反射防止・パッシベーション膜の試作と評価
○田中 昂・鹿又健作・三浦正範・有馬 ボシール アハンマド・久保田 繁・廣瀬文彦(山形大)
6. $\text{YVO}_4:\text{Bi}$, Sm 蛍光体におけるエネルギー移動過程
○五十嵐拓真・グエン ドウック ビン・阿部泰雅・加藤有行(長岡技科大)
7. イットリウム鉄ガーネット膜を用いたスピン波多出力回路の開発
○古田大貴・後藤太一・金澤直樹・熊岡史哉・中村雄一・リム パンボイ・高木宏幸・井上光輝(豊橋技科大)
8. 金属酸化物薄膜堆積のための触媒反応生成高エネルギー H_2O ビーム
○寺口祐介・田島諒一・中村友紀・高橋一匡・玉山泰宏・安井寛治(長岡技科大)
9. 触媒反応生成高エネルギー H_2O ビームを用いて堆積した ZnO 薄膜への NO ガス添加効果
○石塚侑己・田島諒一・大橋優樹・玉山泰宏・安井寛治(長岡技科大)
10. 大気圧 CVD 法によって成長した酸化亜鉛薄膜の結晶学及び光学的特性への窒素添加効果
○寺迫智昭(愛媛大)・矢木正和(香川高専)

☆CPM 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

11月26日(木), 27日(金) 阪市大学術情報センター [締切済] テーマ: 窒化物半導体光・電子デバイス, 材料, 関連技術, 及び一般

12月1日(火)~3日(木) 長崎県勤労福祉会館 [締切済] テーマ: デザインガイア 2015-VLSI 設計の新しい大地-